

1. 冷却水を流し、装置の電源とロータリーポンプ（粗引き用）とターボ分子ポンプ（本引き用）の電源をONにする。
2. V4をOPENにして、チャンバー内を大気開放後、基板をセットしチャンバーをセットする。
3. V4をCLOSEした後、V3をOPENにしてロータリーポンプを開け閉めする。
4. VACUUM READY ランプが点灯した時点でV3をCLOSEにし、V2をOPENにし、粗引き音が完全になくなったのを確認して、V1をOPENにしターボ分子ポンプを開け閉めする。
5. 電離真空計のFILをONする。
6. 膜厚センサーの電源ONする。 ※点滅していたらやり直し
7. ヒーターの電源ONする。
8. 所定の到達圧力（例えば 3×10^{-3} ）に達したら電離真空系OFF、この時迄に試料を加熱しておく。
9. ガスを流す。
10. RF（高周波）の電源ON、スイッチON。
11. チャンバー内のガス圧力を上げてプラズマを着火する。 ※圧力を上げすぎるとTMPが落ちる
12. RF powerをセット、ガス流量、スパッタ圧の本設定を行う。 ※例えば50W、12sccm、0.67Pa
13. reflected powerの調整を行う ※0が良い、値が大きくなると装置が停止する
14. プラズマで5分ほど基板洗浄後、シャッターを開けてターゲットを基板にスパッタする。
15. ダイヤルを0に戻して、RFをOFFする。
16. ガスを止め、ヒーターを止め、V4を開けて大気解放後、基板を取り出す。
17. 装置の劣化を防ぐため、チャンバー内を真空に保ち、終了作業（真空度測定計OFF、ターボ分子ポンプOFF、ロータリーポンプOFF、本体メインスイッチOFF、冷却水CLOSE）を行う。

※取り扱いの詳細は手順書を参照すること。不明な点はすぐに担当まで連絡すること。